

Inhalt

| | | Seite |
|--|---|-------|
| Dimensionelles Messen an Normalen und Werkstücken | | |
| <i>H. Kunzmann</i> | Sichern der Einheitlichkeit von Längen- und Winkelmaßen – Aufgabe der PTB seit 100 Jahren | 3 |
| <i>G. Wilkening</i> | Die Wellenlänge als Maßstab | 25 |
| <i>H.-J. Rademacher und F. Lüdicke</i> | Kalibrierung langer Maß- und Geradheitsverkörperungen | 41 |
| <i>A. Abou-Zeid</i> | Einsatzmöglichkeiten von Diodenlasern in der Fertigungsmeßtechnik | 55 |
| <i>P. Seyfried</i> | Silicium-Kristalle als Maßverkörperung von Länge und Winkel | 67 |
| <i>F. Wäldele</i> | Kalibrierung von Koordinatenmeßgeräten | 81 |
| <i>K. H. Breyer</i> | Wann nutzt die rechnerische Korrektur von Meßabweichungen dem Anwender von Koordinaten- meßgeräten? | 105 |
| <i>H.-H. Schüßler</i> | Industrieroboter in der Koordinatenmeßtechnik | 127 |
| <i>T. Pfeifer</i> | Konzepte für die fertigungsintegrierte Meßtechnik und Qualitätsprüfung | 147 |
| <i>F. Ertl und R. Zapf</i> | Qualitätskontrolle in der Fertigung | 167 |
| <i>A. Ernst</i> | Digitale Positionsmesssysteme für Längen und Winkel | 187 |
| <i>P. Langenbeck</i> | Produktionsbegleitende in-situ Interferometrie | 207 |

Industrielle Anwendungen optischer Meßverfahren

| | | |
|---|--|-----|
| <i>W. Wester- Ebbinghaus</i> | Photogrammetrie – räumliche Punktbestimmung durch Triangulation mit Richtungsbündeln | 225 |
| <i>M. Claus</i> | Automatische, photogrammetrische Oberflächenmessung von Industrieprodukten | 241 |
| <i>M.A. Hüttersen</i> | Anwendungsgebiete für 3-D-Messungen mit Theodolite an Raumfahrt-Körpern | 251 |
| <i>H. Bodschinna</i> | Einsatzmöglichkeiten optischer Verfahren zur Rauheitsmessung in der industriellen Fertigung | 261 |
| <i>D. Kurz</i> | Einführung in die Rasterelektronenmikroskopie und neue Entwicklungen | 279 |
| <i>U. Eckstein</i> | Anwendung des Rasterelektronenmikroskops (REM) in der Technik | 293 |
| <i>G. Schröder</i> | Mikroskopische Meßtechnik | 305 |
| <i>W. Mirandé</i> | Strukturbreitenmessung mit lichtoptischen Verfahren | 319 |
| <i>R. F. Bittner und A. Rohde</i> | Dickenmessung transparenter Schichten mit einem Simultanspektrometer | 331 |
| <i>R. Nawrath und P. Schmidt</i> | Hochgenaue Vermessung im Nanometer-Bereich | 343 |
| <i>G. Schlüter</i> | Anwendungsmöglichkeiten der Raster-Tunnelmikroskopie | 351 |
| <i>G. Doemens</i> | Visuelle Sensoren für die Automatisierung und Qualitätssicherung | 367 |
| <i>J. Otto, E. Plies und J. Quincke</i> | Schaltungsanalyse in ICs mit dem Rasterlasermikroskop | 381 |
| <i>G. E. A. Meier</i> | Automatische Auswertung von Interferogrammen | 395 |
| | Referentenverzeichnis | 407 |